

第34回熊谷記念真空科学論文賞、真空技術賞・第18回真空進歩賞

候補業績募集要領

日本真空協会

本賞は真空科学、真空技術およびその関連分野など（たとえば、表面・薄膜などの分野も含む）の発展に寄与するために、この分野で公表された顕著な業績を「熊谷記念真空科学論文賞・真空技術賞・真空進歩賞規程」（下記）にしたがって表彰するもので、第6回真空科学国際会議開催を記念する基金、熊谷記念基金及び寄附金をもって運用されています。なお、表彰対象となる論文は本誌掲載のものに限りますのでご注意ください。（受賞対象に関しましては、過去10年間の表彰業績一覧をご参照下さい。）

論文賞・技術賞・真空進歩賞候補に推薦され、また応募された業績に対して行いますので、自薦他薦とも下記要領によりご応募下さい。

1. 提出書類：候補業績名（論文の場合は論文名）、公表年月日（論文の場合は「真空」号、巻、頁）、推薦理由または応募理由（400字以内）、および推薦者名または応募者名を記入した A4 判書きの書類（書式任意）
2. 提出先：日本真空協会事務局
〒105-0011 東京都港区芝公園 3—5—8 機械振興会館：TEL(03) 3431—4395
3. 論文賞等の表彰対象：本誌の Vol. 51, No. 4 から Vol. 52, No. 3（平成20年4月～平成21年3月）に掲載された論文
4. 提出期限：平成21年5月8日（金）（厳守）

以上

熊谷記念真空科学論文賞・真空技術賞・真空進歩賞規程

第1条 この規程は真空科学および真空技術の向上と発展に寄与した顕著な業績に対して日本真空協会が行なう表彰について定める。

第2条 真空科学に関する表彰を「熊谷記念真空科学論文賞」、真空技術に関する表彰を「真空技術賞」、若手会員の業績を表彰するものを「真空進歩賞」という。

第3条 この表彰の基金は第6回真空科学国際会議記念基金と寄附金をもって当てる。表彰に要する経費は基金の利息をもって当てることを原則とする。

第4条 表彰への応募資格および被推薦資格は原則として本会会員による業績とする。

第5条 熊谷記念真空科学論文賞の対象は、原則として表彰を行なう年の3月までの1年間に発刊された「真空」誌に発表された独創的な優秀論文とする。ただし数年にわたって継続発表されたものを含む。

第6条 真空技術賞の対象は、表彰を行う年の3月までに公知となっている優れた製品、開発された新技術および技術論文などとする。ただし、技術論文は原則として表彰を行なう年の3月までの1年間に発行された「真空」誌に発表されたものに限る。

第7条 真空進歩賞は真空に関する学理および技術の進歩に貢献する当該年度4月1日現在35歳以下の若手会員の業績を表彰するものとする。

第8条 表彰は第5条、第6条、第7条に該当する業績を

あげた個人または団体に対する賞状および副賞記念品贈呈をもって行なう。賞状は共同研究、共同開発の場合には関係者全員に贈り、団体の場合にはその代表者1名に贈る。

第9条 表彰件数は原則として毎年「熊谷記念真空科学論文賞」および「真空技術賞」「真空進歩賞」各1件とし、該当するものの無い場合には取り止め次年度に繰り越さない。

第10条 表彰は毎年真空に関する連合講演会会期中に会長が行なう。

第11条 表彰の受賞業績を選考するため、表彰審査委員会を設ける。

第12条 受賞業績は会員の推薦または公募に応じた候補中より選考する。

第13条 表彰審査委員会委員長は、受賞業績候補を決定し、意見とともに理事会に提出する。

第14条 理事会は前条により提出された受賞業績候補について、審議のうえ、受賞業績ならびに受賞者を決定する。

第15条 この規程の改廃は総会の決議による。

附則

1. この規程は昭和51年2月21日より施行する。
2. 昭和51年度表彰（第1回）に限り、第5条、第6条にかかわらず、受賞業績の対象を最近数年間に公表されたものとするができる。

（平成4年2月28日改訂）

過去10年間の熊谷記念真空科学論文賞・真空技術賞・真空進歩賞 表彰業績一覧

第24回熊谷記念真空科学論文賞（平成11年度）

「プラズマ中のダスト挙動の解析とクーロン結晶の形成」
林 康明，高橋和生，佐藤英則（京都工芸大学工学部）

第24回真空技術賞（平成11年度）

「真空ガラス「スペーシア」の開発」
河原秀夫，御園生雅郎，浅野 修，加藤英美（日本板硝子㈱），Richard E. Collins（シドニー大学物理学教室）

第8回真空進歩賞（平成11年度）

「UHV/XHV 真空材料の表面処理技術の開発とその実用化」
稲吉さかえ（日本真空技術㈱筑波超材料研究所）

第25回熊谷記念真空科学論文賞（平成12年度）

該当なし

第25回真空技術賞（平成12年度）

「真空遮断器・開閉器用たる形ベローズの開発」
森田 歩，梶原 悟，谷水 徹（㈱日立製作所），高橋正行（㈱三菱電機），橋本隆範（㈱久世ベローズ工業），四元善治（㈱東京電力）

第9回真空進歩賞（平成12年度）

「ガasketの変形挙動観察および内部応力解析に基づくコンフラットシール機構の考察とデーパシー型ガasketの開発」
黒河内 智（日本バックスメタル㈱）

第26回熊谷記念真空科学論文賞（平成13年度）

「負イオン注入によるポリスチレン表面の神経細胞接着特性の改質とパターン化処理」
辻 博司，佐藤弘子，佐々木仁志，後藤康仁，石川順三（京都大学大学院）

第26回真空技術賞（平成13年度）

「磁石内蔵型冷陰極マグネトロン真空計の開発」
麻蒔立男，八木原美奈，増井典明，三浦 勉（東京理科大学工学部電気工学科）

第10回真空進歩賞（平成13年度）

「シリコン表面でのピスマスナノワイヤの発見と物性探索」
内藤正路（九州工業大学工学部）
熱エネルギー原子線散乱法による吸着脱離過程の測定
柳生進二郎（筑波大学理工工学系）

第27回熊谷記念真空科学論文賞（平成14年度）

該当なし

第27回真空技術賞（平成14年度）

「カーボンナノチューブを電子源とした超高輝度光源管の開発」
余谷純子，上村佐四郎，長廻武志，倉知宏行，山田弘，江崎智隆（伊勢電子工業開発部）
斎藤弥八（三重大学工学部）
安藤義則，超 新洛（名城大学理工工学部）

湯村守雄（産業技術総合研究所新炭素系材料開発センター）

「リチウムイオンの付加反応を利用した質量分析法の開発」

岩瀬啓一郎，藤井敏博（国立環境研究所）
中村 恵（アネルバ㈱）

第11回真空進歩賞（平成14年度）

「Pd(111)表面における水素原子の吸収反応」
信原邦啓（大阪大学大学院工学研究科応用物理学専攻在学）

第28回熊谷記念真空科学論文賞（平成15年度）

「走査トンネル顕微鏡によるCu(111)上のCOの分子操作に関する理論」
的場賢一，三浦良雄，笠井秀明，中西 寛（大阪大学）
三浦良雄（科学技術振興財団）
興地斐男（和歌山工業高等専門学校）

第28回真空技術賞（平成15年度）

「特殊形状ベローズを用いたドライポンプの開発」
村上義夫，湯山純平（㈱アルバック）

第12回真空進歩賞（平成15年度）

「Ti(0001)単結晶表面での水素吸収過程に関する研究」
Markus Wilde（東京大学生産技術研究所）

第29回熊谷記念真空科学論文賞（平成16年度）

該当なし

第29回真空技術賞（平成16年度）

「電子-イオンコインシデンス分光装置の開発」
漁 剛志，田中健一郎，吉田啓晃（広島大学大学院理学研究科）
上野信雄，奥平幸司，森 正信（千葉大学工学部）
小林英一，間瀬一彦（物質構造科学研究所）
長岡伸一（愛媛大学理学部物質理学科化学系）
「デュアルイオンビームスパッタ法を用いたAu超薄膜の作製とその紫外域透明電極への応用」
岩坪 聡（富山県工業技術センター）

第13回真空進歩賞（平成16年度）

「超高真空対応配向分子線ビームラインの開発」
盛谷浩右（大阪大学大学院理学研究科化学専攻）

第30回熊谷記念真空科学論文賞（平成17年度）

「Si(100)上ゲルマン吸着に伴う水素移動とGe/Si原子交換の観察」
村田威史，末光眞希（東北大学学際科学国際高等センター）

第30回真空技術賞（平成17年度）

「ねじれを吸収する溶接偏芯ベローズの開発」
津金洋之，清水広幸，三柴 隆（㈱ミラプロ）
吉岡正人（山梨大学工学部）

第30回真空技術賞（平成17年度）

「アークプラズマガンを用いた新規材料 GeC 薄膜の分子線エピタキシー成長」

布下正宏，太田 淳（奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科）

沖仲元毅（理化学研究所ナノサイエンス研究技術開発・支援チーム）

第14回真空進歩賞（平成17年度）

該当なし

第31回熊谷記念真空科学論文賞（平成18年度）

該当なし

第31回真空技術賞（平成18年度）

「極高真空用残留ガス分析計の開発」

渡辺文夫（㈱真空実験室）

第15回真空進歩賞（平成18年度）

「高濃度オゾンガス局所リアルタイム濃度測定法の開発」

佐藤陽亮（産業技術総合研究所，東京理科大学）

第15回真空進歩賞（平成18年度）

「鏡面反射成分を考慮したオリフィス透過確率のモンテカルロシミュレーション」

城 真範（産業技術総合研究所）

第32回熊谷記念真空科学論文賞（平成19年度）

「熱尖端流によって駆動される真空ポンプ内の希薄気流の数値解析」

杉元 宏（京都大学工学研究科航空宇宙工学専攻）

第32回真空技術賞（平成19年度）

「チタンの真空特性の研究と真空材料としての応用」

松浦 満，栗巢普揮，山本節夫，木本 剛，藤井寛朗，田中和彦（山口大学工学部）

石澤克修，野村 健，村重信之（三愛プラント工業株式

会社）

森本高志，部坂正樹（新光産業株式会社）

宗山悦博，竹田将利，國重敦弘，中川浜三，白水啓太，二井裕之（株式会社 UBE 科学分析センター）

第32回真空技術賞（平成19年度）

「大口径・長尺アルミナセラミックダクトの製作」

壁谷善三郎（三菱重工業株式会社）

金正倫計（原子力開発研究機構）

齊藤芳男（高エネルギー加速器研究機構）

萩原徳男（原子力開発研究機構）

第16回真空進歩賞（平成19年度）

「リアルタイム光電子分光観察を用いた表面研究」

小川修一（東北大学多元物質科学研究所）

第33回熊谷記念真空科学論文賞（平成20年度）

「ラジカル窒化シリコン酸窒化膜における窒素プロファイルの X 線光電子分光分析による評価」

河瀬和雅（三菱電機）・梅田浩司・井上真雄（ルネサステクノロジ）・諏訪智之・寺本章伸・服部健雄・大見忠弘（東北大学）

第33回真空技術賞（平成20年度）

「マイクロ/ナノイオンビームの生成技術」

成沢 忠（高知工科大学），根引拓也（高知工科大学）

第17回真空進歩賞（平成20年度）

「高速陽子の散乱を用いたイオン結晶表面の構造解析」

深澤優子（大阪教育大学教育学部）

第17回真空進歩賞（平成20年度）

「ネオン固体表面上からイオン衝撃脱離するクラスターイオンの観測」

立花隆行（立教大学先端科学計測研究センター）